

EUV-FEL WORKSHOP

加速器科学が拓く革新的イノベーション
～半導体 LSI 製造プロセス用 EUV 光源をめざして～

参加費
無料
定員 120 名

開催 2016 12.13 Tue 10:00-17:30

web 申込み先

申込み締切 12月9日(金)まで



ホームページ

http://pfwww.kek.jp/PEARL/EUV-FEL_Workshop/

開催場所

秋葉原 UDX 4F 「NEXT-1」



UDX access

<http://www.udx-n.jp/access.html>

お問い合わせ

高エネルギー加速器研究機構
研究支援戦略推進部
大学・産業連携推進室
TEL.029-879-6239

基調講演

「Big Data時代のCognitive Computingに向けたNeuromorphic Device」

"Neuromorphic Device for Cognitive Computing in the Big Data era"

日本アイ・ビー・エム(株) 東京基礎研究所 サイエンス&テクノロジー 部長 新川崎事業所長 山道 新太郎 氏
IBM Japan Senior Manager Shintaro Yamamichi

招待講演

「半導体集積回路の微細化とEUVリソグラフィ」

"Scaling of Semiconductor Integrated Circuits and EUV Lithography"

(株) 先端ナノプロセス基盤開発センター 代表取締役社長 石内 秀美 氏
EIDEC President Hidemi Ishiuchi

"EUV Lithography Industrialization and future outlook"

エーエスエムエル・ジャパン(株) テクノロジー開発センター ディレクター 宮崎 順二 氏
ASML Japan Co.,Ltd. Director Junji Miyazaki

主催：EUV-FEL 光源産業化研究会、高エネルギー加速器研究機構

共催：産業技術総合研究所

後援：TIA



10:00 開会挨拶 研究会代表 石原直 (東京大学)
Sunao Ishihara, The University of Tokyo

基調講演 【Keynote】

10:10 「Big Data時代のCognitive Computingに向けたNeuromorphic Device」
"Neuromorphic Device for Cognitive Computing in the Big Data era"
山道 新太郎 (日本アイ・ピー・エム)
Shintaro Yamamichi, IBM Japan

招待講演 【Invited】

10:50 「半導体集積回路の微細化と EUV リソグラフィー」
"Scaling of Semiconductor Integrated Circuits and EUV Lithography"
石内 秀美 (先端ナノプロセス基盤開発センター)
Hidemi Ishiuchi, EIDEC

11:25 "EUV Lithography Industrialization and future outlook"
宮崎 順二 (エーエスエムエル・ジャパン)
Junji Miyazaki, ASML Japan

12:00

 昼食

一般講演

13:15 「自由電子レーザー "SACLA" とその基礎」
"Free-electron laser SACLA and its basic"
大竹 雄次 (理化学研究所)
Yuji Otake, RIKEN

13:40 「ERL を用いた高出力 EUV-FEL 光源」
"ERL-Based High-Power EUV-FEL Source"
中村 典雄 (高エネルギー加速器研究機構)
Norio Nakamura, KEK

14:05 「高強度 EUV 光源用高耐久性 EUV 多層膜ミラーの開発」
"Development of damageless EUV multilayer mirrors for high intensity EUV sources"
市丸 智 (NTTアドバンステクノロジー)
Satoshi Ichimaru, NTT Advanced Technology

14:30 「半導体量産用 250W LPP-EUV 光源開発の現状と将来」
"250W LPP-EUV Light Source Development for Semiconductor HVM"
山崎 卓 (ギガフォトン)
Taku Yamazaki, Gigaphoton

14:55 「加速器の応用 — 基礎科学から一般産業へ」
"Applications of Accelerators - from Basic Science to Industrial Use"
佐藤 潔和 (東芝)
Kiyokazu Sato, Toshiba

招待講演 【Invited】

15:20 "EUV free-electron laser requirements and considerations for semiconductor manufacturing"
Erik R. Hosler, GLOBALFOUNDRIES

15:45

 コーヒーブレイク

16:15 **パネルディスカッション 「～ EUV-FEL 光源の実現に向けて～」**
Panel Discussion " — To realize EUV-FEL light source — "

17:25 閉会挨拶 神谷 幸秀 (高エネルギー加速器研究機構)
Yukihide Kamiya, KEK

17:30 閉会